



## ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

# МАГНА ТМ 200

### Назначение:

Нанесение многокомпонентных и многослойных металлических или диэлектрических тонких плёнок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.

### Особенности:

- Обработка подложек в одном технологическом цикле: 60x48 мм - 3шт.;  
Ø 76,100,150,200 мм - 1шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Планарное МПУ с мишенью Ø 280 мм или мультикаатодное МПУ с тремя мишенями Ø 100 мм;
- Скоростное нанесение из трех магнетронов одной пленки или последовательное нанесение двух-, трехслойных пленок с использованием заслонки;
- Вращающийся ВЧ электрод с нагревом и очисткой подложек в ВЧ плазме;
- Безмасляная (сухая) откачка на базе форвакуумного и турбомолекулярного насосов;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 16 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 5 м<sup>2</sup>.

